

8.4 Tranzistory

Tranzistory¹ jsou zesilovací (aktivní) polovodičové prvky. Je možno je dělit na bipolární² a unipolární³ tranzistory (tabulka 1) podle toho, zda se na zesilování podílí oba typy nosičů nábojů (vodivostní elektrony a díry), nebo jen jeden typ nosičů.

8.4.1 Bipolární tranzistory

Bipolární tranzistory jsou většinou vyráběny na bázi křemiku. Skládají se ze tří na sobě ležících polovodičových vrstev, tvořených střídavě polovodiči typu P a typu N (obr. 1). Podle sledu těchto tří vrstev rozlišujeme typ PNP nebo NPN (tabulka 2). Oba tyto typy tranzistorů se chovají vzájemně komplementárně⁴. Jako jednotlivé tranzistory se používají převážně tranzistory typu NPN.

Všechny tři polovodičové vrstvy mají vyvedeny přívody ven. Střední vrstva se nazývá **báze**, vnější vrstvy pak **emitor**⁵ a **kolektor**⁶. Emitor vysílá (emituje) nosiče nábojů a kolektor je přijímá. Na přechodech z N k P-polovodiči se vytvářejí závěrné vrstvy, které jsou u bipolárního tranzistoru dvě.

Pokus 1: Připojte výkonový tranzistor, např. BD 135 a dva ampérmetry na dva zdroje podle obrázku 2. Měňte zdrojem G1 proud báze I_B a sledujte změny kolektorového proudu I_C .

Malé změny proudu báze ΔI_B vyvolávají velké změny kolektorového proudu ΔI_C .

Cesta báze-emitor je při činnosti tranzistoru v propustném směru, přechod báze-kolektor je pólrován (nastaven) v závěrném směru (emitorová šipka ve schematické značce tranzistoru udává technický směr proudu).

Malá změna proudu báze I_B způsobí v tranzistoru velkou změnu proudu kolektoru I_C (tranzistor má velké proudové zesílení).

Emitorová oblast je u bipolárního tranzistoru silně dotována, kolektorová oblast je dotována méně. Mimořádně tenká vrstva báze (silná jen několik μm) obsahuje jen malé množství cizích atomů. Teče-li proud báze, přetéká sem z emitoru mnoho nosičů nábojů (např. elektronů v případě NPN-tranzistoru) přes tenkou vrstvu báze. Tato vrstva je jen málo dotována, proto může rekombinovat jen malou část elektronů vlastními dírami. Proto je proud báze jen velmi malý.

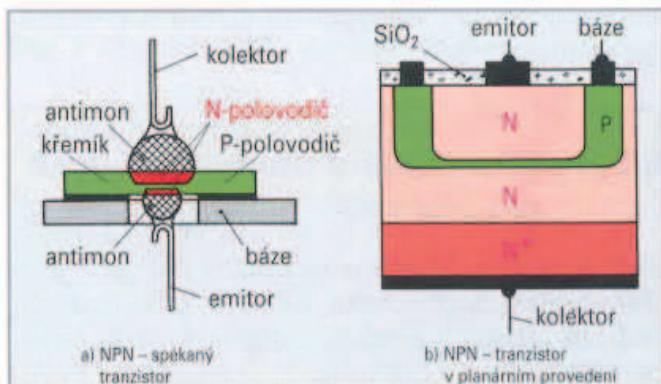
¹ ze slovního spojení TRANSfer reSISTOR = změna odporu

² z latinského bis = dva (krát)

³ z latinského unus = jeden

Tabulka: Typy tranzistorů

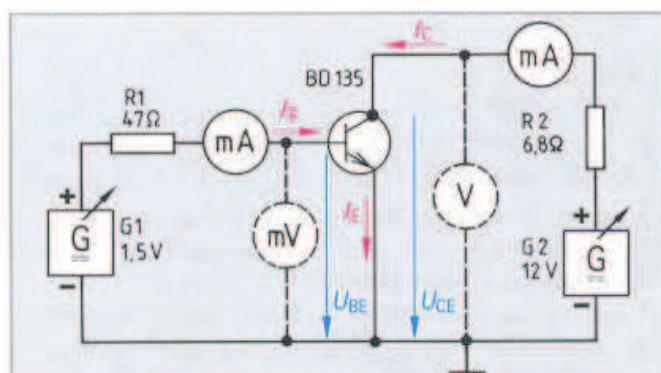
		unipolární tranzistory							
bipolární tranzistory		unipolární tranzistor		FET-tranzistory				MOSFET-tranzistory	
		JFET a MESFET tranzistory		P-kanál		N-kanál			
NPN	PNP	typ-N	P-kanál	N-kanál	indukovaný	zabudovaný	indukovaný	zabudovaný	



Obr. 1 Konstrukce bipolárních tranzistorů

Tabulka 2: Konstrukce a schematické značky bipolárních tranzistorů

typ	pořadí zón	diodový ekvivalent	schematická značka
NPN			
PNP			



Obr. 2 Zapojení pro měření charakteristik NPN – tranzistoru [v zapojení se společným emitorem]

⁴ komplement = doplněk

⁵ emitovat = vysílat

⁶ kolektor = shromažďovač

Většinu nosičů nábojů tlačí elektrické pole závěrné vrstvy báze-kolektor do kolektoru (obr. 1). Tak vzniká velký kolektorový proud, který je 10-krát až 500-krát větší než proud báze. Poměr mezi proudem kolektoru a odpovídajícím proudem báze nazýváme stejnosměrné zesílení B .

V bipolárním tranzistoru je kolektorový proud řízen proudem báze. K řízení je zapotřebí jen malý výkon.

Je-li napětí báze-emitor $U_{BE} = 0$ V nebo menší než mezní hodnota asi 0,4 V, je tranzistor zavřený. Teče jen zanedbatelný závěrný proud, který je způsoben páry nábojů vzniklými v závěrné vrstvě přechodu báze-kolektor působením tepla.

Pokus 2: Uvažujte charakteristiky tranzistoru, např. BD 135 (zapojení na obr., str. 172) a sice charakteristiku $I_C = f(U_{CE})$ pro různé proudy báze a charakteristiky $I_B = f(U_{BE})$ a $I_C = f(I_B)$ vždy pro pevné napětí U_{CE} , např. pro $U_{CE} = 6$ V.

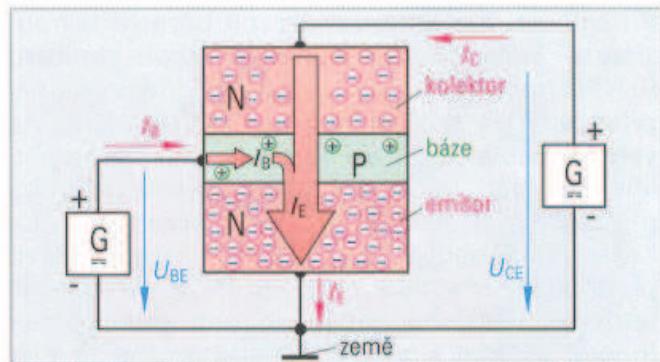
Soustava charakteristik I_C (U_{CE}) ukazuje výstupní charakteristiky pro pevné proudy báze. Charakteristika I_B (U_{BE}) je charakteristikou diody báze-emitor. Funkční závislost I_C (I_B) dává informaci o proudovém zesílení.

Podle zvoleného zapojení rozlišujeme charakteristiky tranzistoru (obr. 2) vstupní (obvod báze-emitor): $I_B = f(U_{BE})$ a výstupní (obvod kolektor-emitor): $I_C = f(U_{CE})$. Šipky označující směry proudů je třeba zvýraznit, neboť emitorový proud je součtem proudu báze a proudu kolektoru (obr. 1). Orientační šipky napětí jsou dány položením napájecích provozních napětí.

Krystal tranzistoru i s vývody je vestavěn v pouzdře (tabulka), které je buď z plastu nebo z kovu.

8.4.2 Nastavení pracovního bodu

Tranzistor se používá jako zesilovač, nebo jako spínač. Nejběžnější zapojení je **zapojení se společným emitorem**. V tomto zapojení je emitor připojen na zem (obr. 1), je tedy společným připojením vstupu i výstupu. Vstupní signál je přiveden na bázi (proti zemi, čili emitoru) a výstupní signál je na kolektoru (proti zemi, čili emitoru). Změny kolektorového proudu způsobené změnami proudu báze se na odporu zátěže mění na změny napětí. V zapojení tranzistoru je napětím kolektor-emitor U_{CE} a stejnosměrným předpětím báze-emitor U_{BE} nastaven pracovní bod tranzistoru.



Obr. 1 Proudové v tranzistoru NPN
(zapojení se společným emitorem)

B stejnosměrné proudové
zesílení

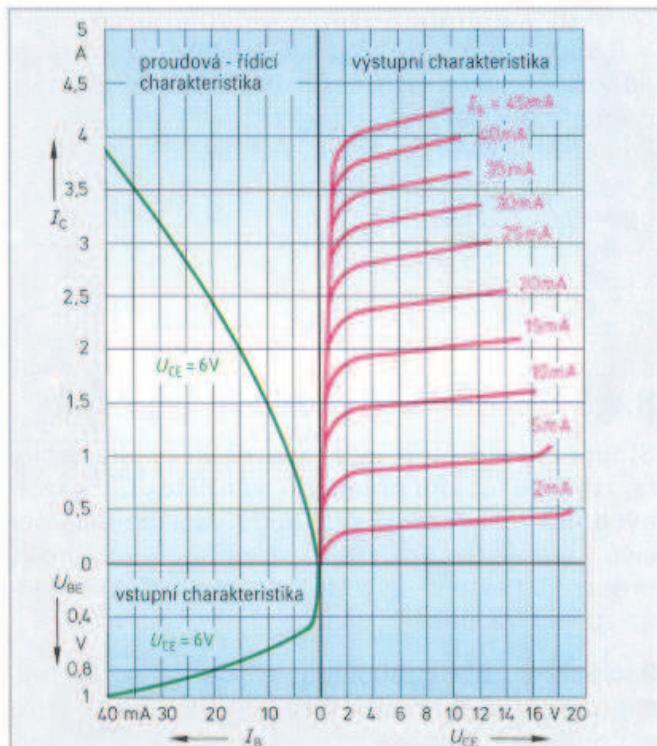
$$B = \frac{I_C}{I_B}$$

I_C proud kolektoru

$$I_E = I_B + I_C$$

I_B proud báze

I_E proud emitoru



Obr. 2 Soubor charakteristik bipolárního tranzistoru

Tabulka: Pouzdra tranzistorů

pohledy	označení	pohledy	označení
	10 A 3 (TO 92)		14 A 3 (TO 220)
	18 A 3 (TO 18)		
	50 A 3 (TO 50)		3 B 2 (TO 3)
	12 A 3 (TO 126)		B báze C kolektor E emitor

Při činnosti tranzistoru musí mít báze NPN-tranzistoru stále kladný potenciál proti emitoru (u NPN tranzistoru stále záporný). Střídavý signál přiváděný na bázi proti zemi (emitoru), tj. na vstup zesilovače, může být vstup jen v rozpetí lineární části vstupní charakteristiky, jinak by mohlo dojít při zesílení ke zkreslení tvaru signálu. Ke splnění tohoto požadavku je třeba nastavit předpětí vstupu (báze proti zemi či emitoru) a na toto stejnosměrné napětí se pak superponuje (přičte) vstupní signál. Předpětí báze nastavujeme buď předřadným odporem z napájení (obr. 2a) nebo vstupním děličem (obr. 2b). Vstupní dělič je odolnější proti rozptylu parametrů konkrétně použitého tranzistoru i proti kolísání okolní teploty a nastavené předpětí je stabilnější než při nastavení jediným předřadným odporem.

Příklad: Pro tranzistor BCY 59 v emitorovém zapojení (se společným emitorem) při napájení $U_b = 16$ V je třeba nastavit předpětí báze $U_{BE} = 0,62$ V vstupním děličem dle obr. 2b. Určete odpory R_1 a R_2 děliče při povoleném příčném proudu děličem $I_q = 9 \cdot I_B$.

Z charakteristik tranzistoru nalezneme pro $U_{BE} = 0,62$ V hodnotu $I_B = 0,2$ mA.

$$R_2 = \frac{U_{BE}}{9 \cdot I_B} = \frac{0,62 \text{ V}}{1,8 \text{ mA}} = 0,344 \text{ k}\Omega$$

$$R_1 = \frac{U_b - U_{BE}}{10 \cdot I_B} = \frac{16 \text{ V} - 0,62 \text{ V}}{2 \text{ mA}} = 7,69 \text{ k}\Omega$$

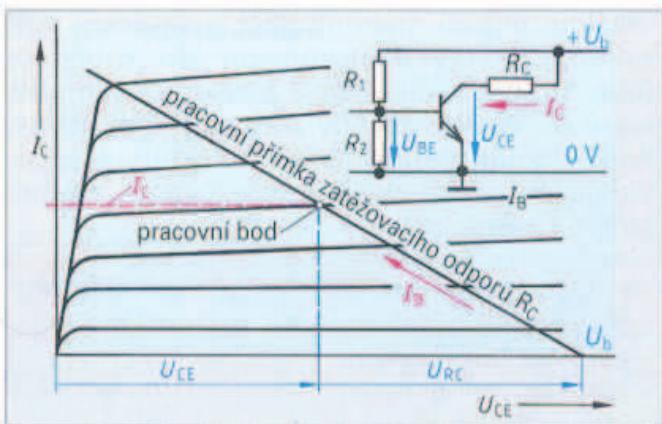
8.4.3 Stabilizace pracovního bodu

Stoupne-li kolektorový proud nebo okolní teplota, zvýší se teplota přechodů tranzistoru. V závěrných vrstvách v okolí přechodů vznikne více nosičů nábojů a tím opět stoupne kolektorový proud a kolektorová ztráta (termo-elektrická kladná zpětná vazba).

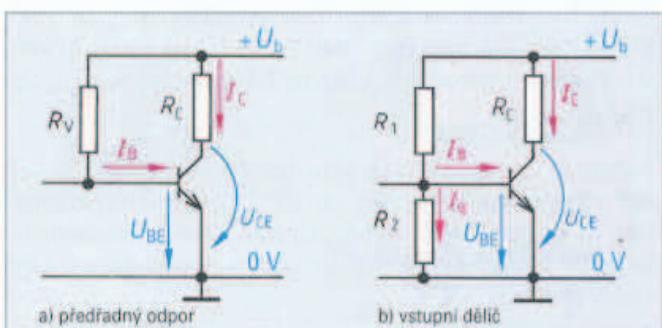
Potřebnou stabilizaci pracovního bodu může zajistit např. NTC-termistor (obr. 3), který má kontakt s pouzdrem tranzistoru. Při zahřátí se zmenší odpor termistoru, tím klesne předpětí U_{BE} a v důsledku toho klesne kolektorový proud I_C . Pro přizpůsobení teplotní charakteristiky termistoru se k němu připojuje paralelně ještě ohmický odpor, což je nutné např. u výkonových tranzistorů.

Pokud nepřipojíme vstupní dělič na napájení, ale přímo na kolektor (obr. 4a), bude působit přes odpor R_1 záporná napěťová zpětná vazba. Při nárůstu I_C , klesne U_{CE} a tím i předpětí U_{BE} . Tato záporná zpětná vazba zeslabí i vstupní signál a tedy i zesílení zesilovače.

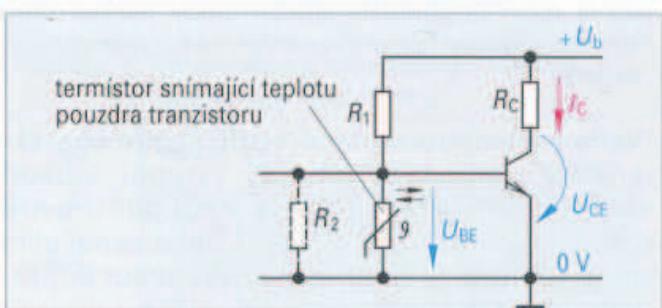
Tuto nevýhodu odstraňuje nejčastěji používaná **negativní proudová vazba** přes emitorový odpor R_E (obr. 4b). Nárůst kolektorového proudu způsobi nárůst úbytku napětí na emitorovém odporu R_E a tím zmenší předpětí báze U_{BE} . Aby potenciál emitoru vůči zemi nekolísal v rytmu zesílovaného střídavého signálu (a tím i pracovní bod), je střídavý signál zkratován z emitoru na zem emitorovým kondenzátorem C_E .



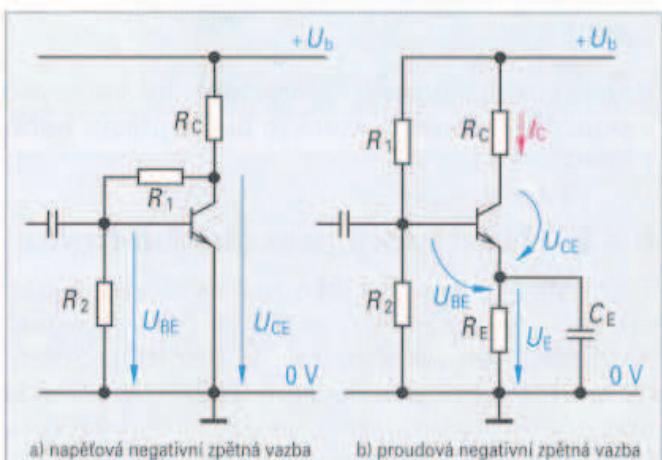
Obr. 1 Určení pracovního bodu



Obr. 2 Nastavení předpětí báze-emitor



Obr. 3 Stabilizace pracovního bodu NTC-termistoru



Obr. 4 Stabilizace pracovního bodu pomocí napěťové a proudové negativní zpětné vazby

8.4.4 Tranzistory řízené polem (FET)

V unipolárních tranzistorech je ovlivňováno zesílení jen jedním druhem nábojů, buď jen elektrony, nebo jen dírami. Tranzistory řízené polem (**Field-Effect Transistor, FET**) jsou tvořeny křemíkovým monokrystalem s dotací typu N nebo P (obr. 1), který je na obou koncích opatřen vodivými kontakty. Vysoká dotace přiměsi na kontaktích plochách (P^+ na obr. 1) přitom zabraňuje vytvoření závěrné vrstvy mezi polovodičem a kovem. Závěrná vrstva se vytváří až mezi P^+ a N kanálem (závěrná vrstva tranzistoru J¹-FET s vodivým spojením hradla-gate a kanálu). Hlavní elektrody FET tranzistoru se označují jako **Source**² (zdroj volných nosičů) a **Drain**³ (odsávač volných nosičů). Po stranách dráhy mezi Source (S) a Drain (D) jsou 2 propojené plošky tvořící řídící elektrodu **Gate**⁴ (G), resp. hradlo. Silně dotované zóny hradla (P^+) odpuzují kolem procházející nosiče nábojů a vykláňejí jejich dráhy do středu mezi ploškami hradla. Při zapojení napětí mezi G a S v závěrném směru se rozšíří kolem plošek hradla zóny bez volných nosičů nábojů a zúží se tím vodivý kanál pro nosiče nábojů. Závěrné napětí hradla zmenšuje průřez kanálu.

V unipolárním FET tranzistoru je odpor v kanálu mezi elektrodami Source a Drain řízen elektrickým polem kolmým ke kanálu.

Velké záporné napětí G-S, U_{GS} zmenšuje průřez kanálu na minimum, utáhne jej. Proud sací elektrody (Drain) I_D , vyvolaný napětím sací elektrody U_{DS} , závisí kromě jiného také na průřezu kanálu. Sací (Drain) proud způsobuje v FET tranzistoru úbytek napětí, který posune oblasti prostorových nábojů směrem k Drain elektrodě. Tím se směrem k Drain elektrodě posune i nejužší místo vodivého kanálu, resp. uzavřené místo kanálu, dosáhne-li G-S napětí velikosti **uzavíracího napětí** (pole charakteristik $I_D = f(U_{DS})$ v obr. 2).

Tranzistory typu J-FET se v současnosti dělají převážně planární technologií (obr. 3). Přitom se struktura tranzistoru vytváří na povrchu křemíkového krystalu. Tyto tranzistory lze řídit nepatrnu energií, mají velký vstupní odpor a hradlem (G) teče jen nepatrny proud v závěrném směru, způsobený tepelným pohybem nosičů nábojů v závěrné vrstvě.

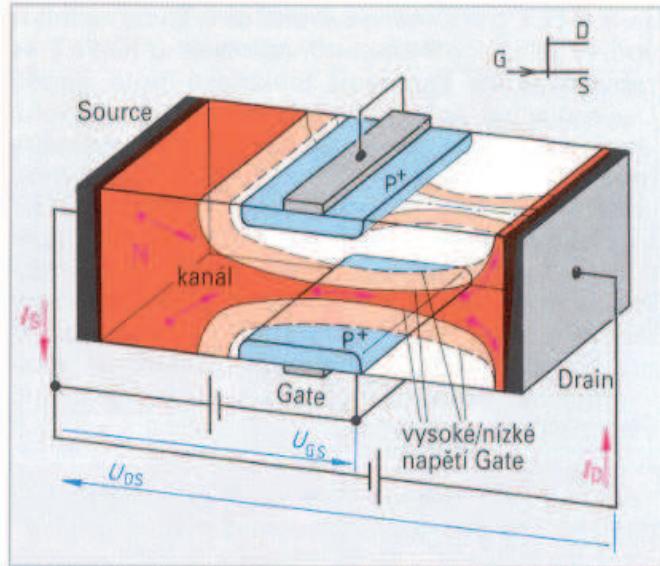
V FET-tranzistorech je výstupní (Drain) proud řízen nepatrnm vstupním výkonem (napětím U_{GS}).

Mimořádně malý hradlový (Gate) proud lze úplně potlačit, odděluje-li kovové elektrody hradla (Gate) od křemíkového krystalu (vodivého kanálu) izolační vrstvou (oxidu křemičitého). Mluvíme pak o FET tranzistorech s izolační vrstvou (IG-FET)⁵. Tyto tranzistory se pro svoji technologii nazývají **Metal-Oxid-Semiconductors**⁶ (MOSFET). Izolací hradla (Gate) se dosáhne extrémně vysokého vstupního odporu (10^{12} – $10^{15} \Omega$), který je nezávislý na velikosti a polaritě napětí U_{GS} . Přes hradlo (Gate) teče nepatrne malý proud několik femtoampérů ($1fA = 10^{-15} A$).

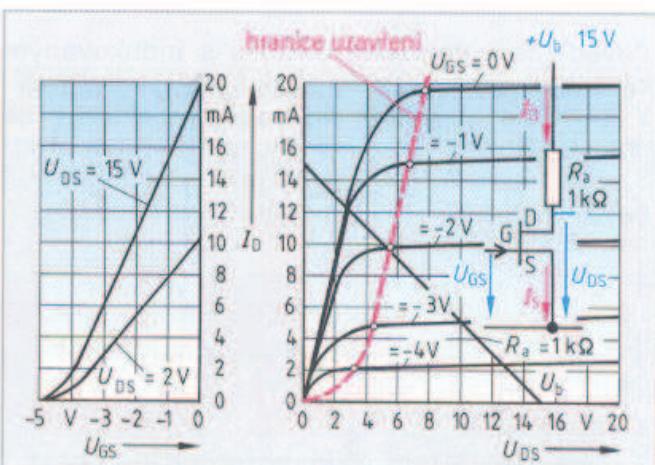
¹ z anglického Junction = spojení

² z anglického Source = zdroj

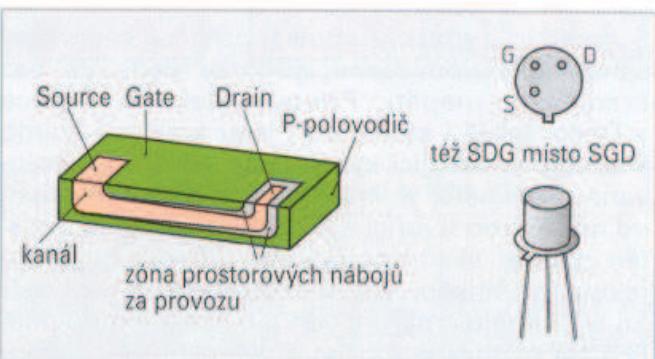
³ z anglického Drain = odvod



Obr. 1 Činnost tranzistoru řízeného polem



Obr. 2 Pole charakteristik JFET s N-kanálem



Obr. 3 JFET s N-kanálem v planárním provedení

⁴ z anglického Gate = brána, závora, hradlo

⁵ z anglického Isolated Gate = izolované hradlo

⁶ z anglického Semiconductor = polovodič

Je-li u FET tranzistoru s izolační vrstvou (IGFET) vodivý kanál i při $U_{GS} = 0$, jedná se o **IG-FET se zabudovaným kanálem**. Elektrické pole napětí U_{GS} vytlačuje pohyblivé nosiče nábojů z kanálu, který je tak ochuzen o elektrony, případně díry (**obr. 1a**). Také FET tranzistory se závěrnou vrstvou jsou takové **ochuzované typy**. **MOSFET s indukovaným kanálem** (**obr. 1b**) není bez napětí U_{GS} vodivý. Vodivý kanál se vytvoří vhodně polarizovaným napětím U_{GS} . Např. při fosforové dotaci křemikového krystalu (substrát typu P) převažují díry a vodivostní elektrony jsou v menšině. Poměr koncentrací dér a elektronů však zůstává zachován.

Při nulovém Source-Gate napětí U_{GS} protéká IG-FET-em se zabudovaným kanálem proud Source-Drain I_{SD} , MOSFET-em s indukovaným kanálem při $U_{GS} = 0$ neteče I_{SD} .

Přivedeme-li na Gate IG-FET-u s indukovaným kanálem typu N (**obr. 1b**) kladné narůstající napětí, přitáhne elektrické pole volné elektrony na povrch krystalu, tzn. vznikne vodivá cesta mezi Source a Drain elektrodami. Zvětšujeme-li na Gate napětí, obohacuje se množství nosičů nábojů v kanále.

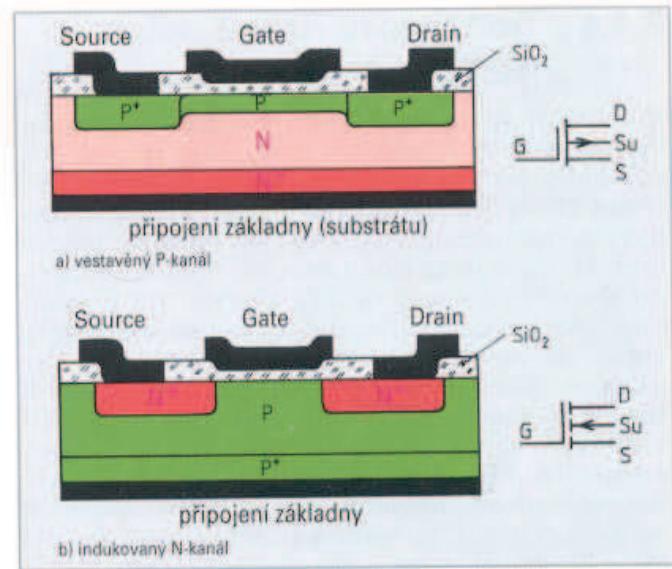
Obohacované MOSFETy (IG-FETy) pracují s indukovaným kanálem, ochuzované IG-FETy mají vestavěný kanál.

Z charakteristik (**obr. 2**) je možno určit strmost S (převodní charakteristiky) a hodnotu diferenciálního odporu r_{DS} (z výstupní charakteristiky).

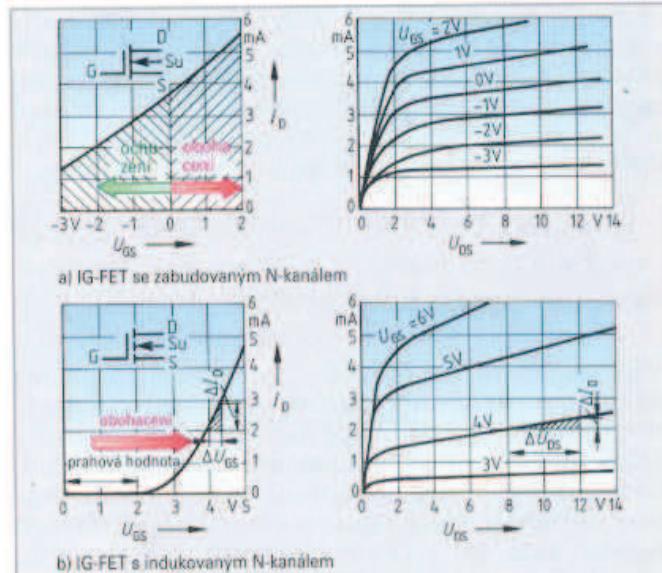
Schematické značky (**tabulka**) označují vestavěný kanál souvislou čarou, protože vede již bez hradlového napětí. Přívody elektrod Source a Drain, jakož i substrátu¹, jsou kresleny kolmo k úsečce označující kanál. Gate elektroda, izolovaná od kanálu, je kreslena v malé vzdálenosti od něj. Přívod (tvořící s Gate písmeno L) je umístěn naproti elektrodě Source. Přívod substrátu je opatřen šipkou, jež orientace určuje typ kanálu, u P-kanálu směřuje ven a u N-kanálu dovnitř. FET tranzistory je možno s výjimkou tranzistorů Unijuktion rozdělit na tranzistory se závěrnou vrstvou, tj. s připojeným hradlem (JFET nebo MESFET²) a s izolovaným hradlem (IG FET, které jsou převážně MOSFET). Dalším kritériem dělení (kromě připojení G k substrátu) je typ nosičů nábojů v kanále P nebo N a dále typ kanálu (vestavěný nebo indukovaný), viz **tabulka 1 na str. 177**. MESFET dostaneme z JFET, nahradime-li P-N přechod mezi G-S Shottkyho diodou, tj. přechodem kov-polovodič. MESFETy se většinou nevyrábějí z křemiku, ale z GaAs, kde je přibližně třikrát větší pohyblivost elektronů.

¹ z anglického substrat = podložka

² MESFET z anglického Metal Semiconductor FET



Obr. 1 Průřez tranzistorem IG-FET (MOSFET)



Obr. 2 Charakteristiky tranzistorů IG FET

S	strmost převodní charakteristiky
ΔI_D	změna proudu Drain
ΔU_{GS}	změna napětí Gate
r_{DS}	diferenciální výstupní odpor
ΔU_{DS}	změna napětí Drain-Source

$$S = \frac{\Delta I_D}{\Delta U_{GS}}$$

$$r_{DS} = \frac{\Delta U_{DS}}{\Delta I_D}$$

Tabulka: Schematické značky MOSFET	
s vestavěným kanálem	s indukovaným kanálem
vestavěný kanál	indukovaný kanál
Gate	Gate
N-kanál	P-kanál

MOSFET-y se vyrábějí jako jednotlivé (diskrétní)¹ součástky, nebo jako prvky integrovaných² obvodů vyráběných planární technologií na bázi křemíku (tabulka 2). Ve vlhké atmosféře se nejprve křemíková destička, dotovaná např. fosforem, pokryje při 900°C izolační vrstvou oxidu křemičitého SiO₂. Na tuto vrstvu se nanese fotocitlivý lak a ten je přes masku osvětlen. Kyselina fluorovodíková (HF) vyleptá osvětlená místa z vrstvičky SiO₂. Do vyleptaných míst může být nanesen např. bor jako dotující prvek, a to difuzí z par diboran-hydridu (B₂H₆). Hradlová vrstva oxidu smí být silná jen 0,12 µm. Získá se suchou oxidaci:



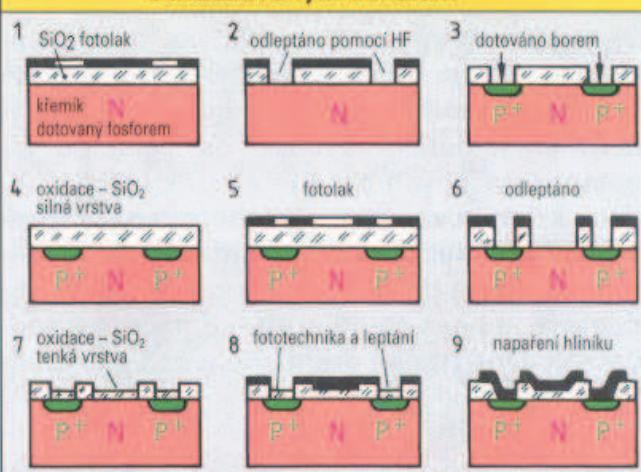
Tato vrstvička oxidu je velmi kompaktní a má relativní permitivitu $\epsilon_r = 3,84$. Přívody elektrod Source, Gate a Drain se získají napařením hliníku ve vysokém vakuu a následným odlepáním přebytečných ploch.

U FET tranzistorů se získává předpětí-Gate pro MOSFET-y s indukovaným kanálem pomocí děliče napětí (tabulka 3). U MOSFET-u s vestavěným kanálem vzniká předpětí-Gate automaticky na odporu source R_S . Tento odpor R_S zároveň slouží ke stabilizaci pracovního bodu pomocí proudové zpětné vazby. Paralelně zapojený kondenzátor C_S zabrání zpětnovazebnímu účinku střídavého napětí.

Tabulka 1: FET-tranzistory kromě Unijunktion – tranzistorů

polovodičový prvek	typ kanálu	nosiče nábojů	schematická značka
FET se závěrnou vrstvou JFET	N-kanál	ochuzované	
	P-kanál	ochuzované	
	N-kanál	obohacované	
	P-kanál	obohacované	
MOSFET			

Tabulka 2: Výroba tranzistoru MOSFET s indukovaným kanálem



Otázky k opakování

- Čím se liší bipolární tranzistory od unipolárních?
- Jak se nazývají vývody a) bipolárního, b) unipolárního tranzistoru?
- Popište konstrukci planárního NPN tranzistoru.
- Čím lze řídit kolektorový proud tranzistoru?
- Jaká je souvislost mezi kolektorem, bází a emitorem?
- Které charakteristiky tranzistoru jsou třeba k návrhu zesilovače?
- Čím lze nastavit pracovní bod bipolárního tranzistoru?
- Proč je třeba stabilizovat nastavení pracovního bodu?
- Vysvětlete efekt pole při řízení unipolárního tranzistoru.
- Co se rozumí u FET tranzistoru uzavíracím napětím?

Tabulka 3: Vytvoření předpětí hradla (Gate)

IGFET (N-kanál indukovaný)	IGFET (N-kanál vestavěný)	JFET (P-kanál)
předpětí pomocí děliče napětí	C_S propouští střídavý proud, odpor $R_G \leq 5\text{M}\Omega$ slouží k odvedení elektrostatických nábojů	

¹ z anglického discrete = oddělený

² z anglického integrate = tvořit komplex